


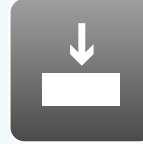

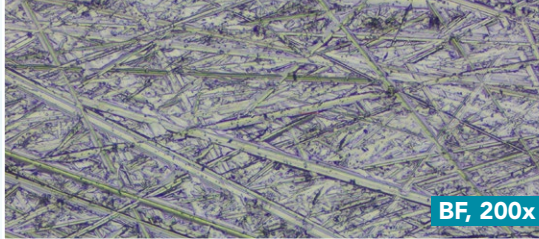
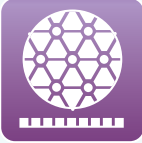


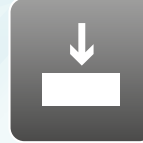

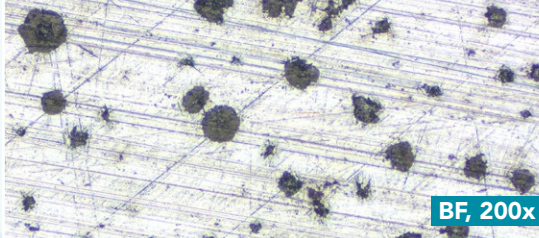



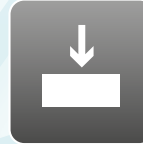

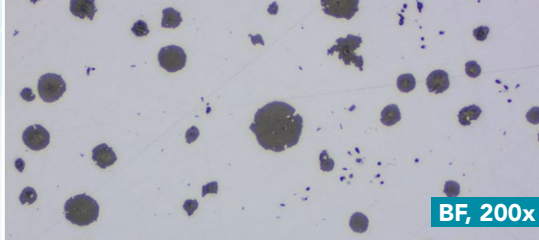



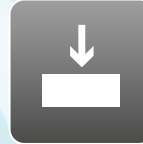

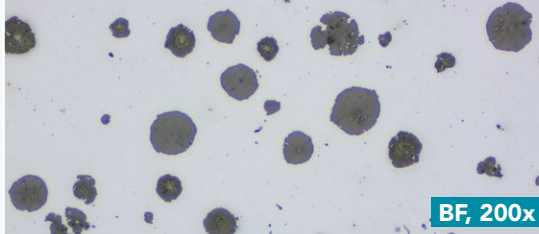


Aka-Brief #14 Gusseisen

1						
	Piatto 220	Wasser	300 UpM	35 N	Bis plan	BF, 200x
2						
	Allegran 3	DiaUltra 9 µm	150 UpM	35 N	3:30 min	BF, 200x
3 ***						
	Silk	DiaUltra 3 µm	150 UpM	35 N	2:30 min	BF, 200x
4 * ***						
	Chemal	Colloidal Silica 50 nm Alkaline**	150 UpM	20 N	1:00 min	BF, 200x

Die angegebene Präparationsdauer gilt für ein 300 mm System und 40 mm Proben-durchmesser.

Mit einem 250 mm System sollte die Dauer um 30 % erhöht werden, mit einem 200 mm System um 100 %.

Für größere Proben sollte die Kraft erhöht, für kleinere Proben reduziert werden.

Die Umdrehungsgeschwindigkeit des Probenhalters beträgt 150 UpM.

Dauer und Kraft kann, abhängig von der Maschine, variieren.

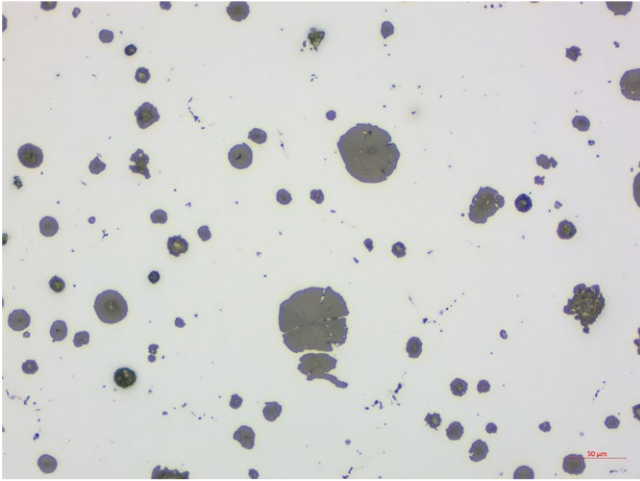
* Schritt 4 ist optional

** Oxidpolieren ergibt eine kratzerfreie Oberfläche, erzeugt jedoch Relief. Um das Relief zu minimieren kann dieser Schritt durch Polieren mit DiaUltra 1 µm auf Napal ersetzt werden.

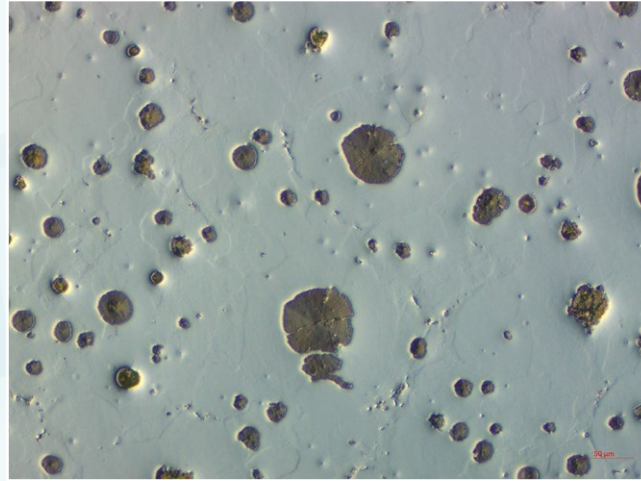
*** Für wasserempfindliche Proben wird ausschließlich Diamantpolieren mit wasserfreien Suspensionen/Schmiermitteln für die 3 µm und 1 µm Schritte empfohlen. Der Einsatz von Wasser soll auch beim Reinigen der Probe nach diesen Schritten vermieden werden.

Aka-Brief #14 Gusseisen

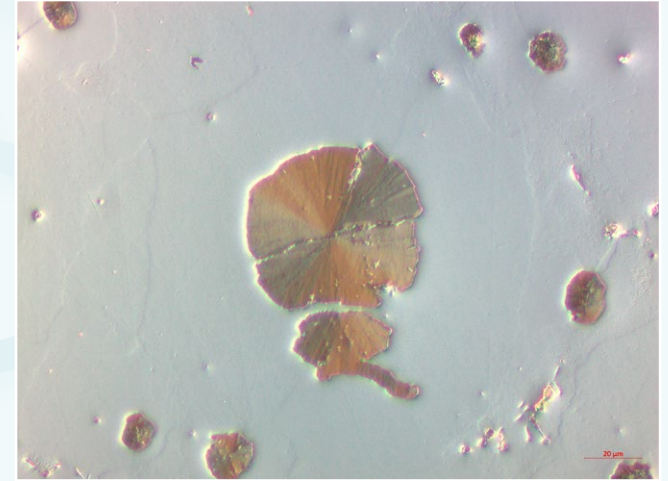
ERGEBNIS



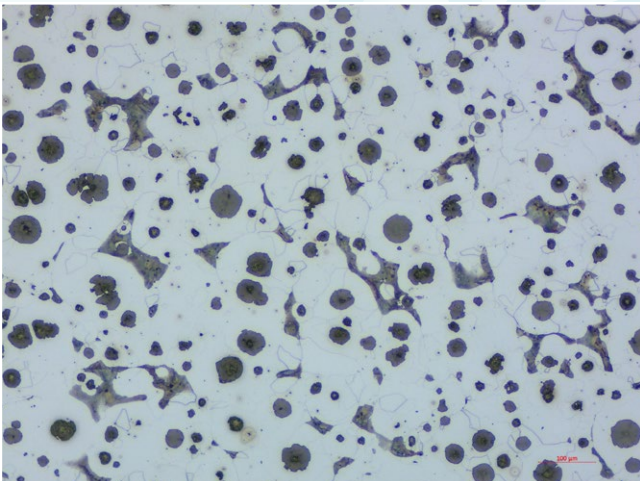
BF, 200x



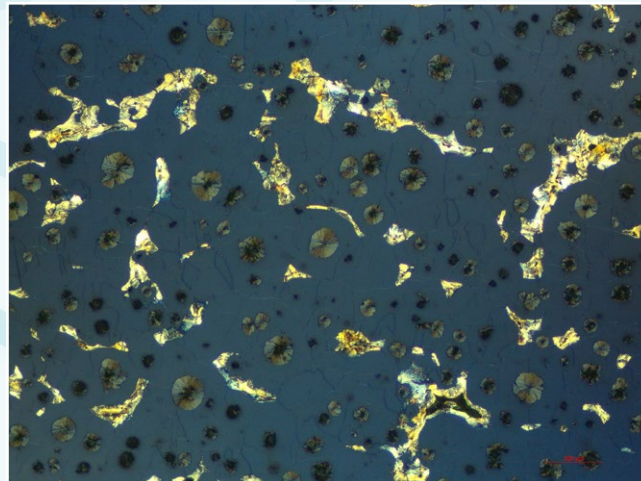
DIC, 200x



DIC, 500x



Geätzt mit 3% Nital, BF, 200x



Geätzt mit 3% Nital, POL, 200x